04:11

Влияние состояния поверхности катода на характеристики импульсного тлеющего разряда с полым катодом

© *H.B. Гаврилов, С.Е. Романов* Институт электрофизики УрО РАН, 620049 Екатеринбург, Россия

(Поступило в Редакцию 6 октября 1997 г.)

Исследовано влияние частоты повторения импульсов $(0.1-10^3~{\rm s}^{-1})$ и среднего тока разряда $(0-1~{\rm A})$ на время запаздывания пробоя и напряжение горения тлеющего разряда низкого давления $(p<0.1~{\rm Pa})$ в электродной системе типа обращенный магнетрон с большой площадью поверхности катода $(\sim10^3~{\rm cm}^2)$. Показано, что увеличение частоты приводит к многократному уменьшению не только статистического разброса времени запаздывания, но и времени формирования разряда, а величина среднего тока разряда оказывает существенное влияние на напряжение его горения. Дана качественная интерпретация механизма наблюдаемых явлений, основывающаяся на наличии тонких диэлектрических пленок на поверхности катода.

Введение

Импульсно-периодический режим горения разряда низкого давления с замкнутым дрейфом электронов внутри катодной полости в слабом магнитном поле используется в плазменных источниках широких пучков электронов и газовых ионов [1,2]. Разряд возбуждается в электродной системе с большими межэлектродными расстояниями (> 10 сm) при низком давлении газа р < 0.1 Ра приложением относительно невысокого импульсного напряжения U амплитудой $2-3\,\mathrm{kV}$. Большая площадь рабочей поверхности полого катода ($\sim 10^3 \, {\rm cm}^2$) и малая скважность импульсов приводят к тому, что значения средней плотности ионного тока на катоде оказываются невысокими, хотя импульсная плотность тока обычно составляет $1-10\,\mathrm{mA/cm^2}$ при длительности импульса тока пучка $au \sim 0.1 - 1 \, \mathrm{ms}$ и частоте повторения $f \sim 1 - 100 \,\mathrm{s}^{-1}$. Для получения вакуума в источниках технологического назначения могут использоваться обычные масляные средства откачки. Необходимость периодической смены образцов приводит к частым контактам поверхности электродов источника с атмосферной средой. Поэтому, несмотря на частичное кондиционирование поверхности катода в тлеющем разряде, на ней могут присутствовать как адсорбированные атомы газа, так и загрязнения.

Экспериментально измеренные в данных условиях времена запаздывания пробоя достаточно велики и составляют десятки—сотни микросекунд. Как показали эксперименты [3,4], время запаздывания зависит не только от приложенного напряжения, давления газа и магнитной индукции, которые определяют скорость роста тока в промежутке при развитии таунсендовских лавин, но и от таких параметров импульсно-периодического режима, как частота повторения импульсов f, длительность импульса тока τ и его амплитуда I. Зависимость результатов измерений времени запаздывания разряда от предыстории разряда и параметров импульсно-периодического режима для других условий горения разряда наблюда-

лась ранее в ряде работ, к примеру в [5,6]. Однако во всех предыдущих исследованиях изучалось изменение средних статистических значений времени запаздывания, тогда как в наших экспериментах [4] наблюдалось существенное изменение времени запаздывания при минимальном статистическом разбросе измеряемых значений. В [4] было показано, что напряжение горения импульсного разряда также зависит не только от величины магнитной индукции B, давления p и амплитудного тока I, но и от частоты повторения импульсов. Поскольку изменение условий зажигания и горения импульсного разряда оказывает существенное влияние на функционирование и параметры пучка источников заряженных частиц на его основе, то изучение особенностей характеристик разряда в импульсно-периодическом режиме является актуальной задачей.

В настоящей работе исследовано влияние частоты повторения импульсов и среднего тока разряда на время запаздывания и напряжение горения импульсного тлеющего разряда с полым катодом больших размеров и предложено качественное объяснение процессов на катоде тлеющего разряда, способных оказать влияние на свойства импульсного разряда в условиях эксперимента.

Эксперимент

В экспериментах использовалась электродная система источника ионов [1] (рис. 1), включающая цилиндрический полый катод I из нержавеющей стали, имеющий одинаковые длину L и диаметр D (150 mm), и стержневой анод 2 из вольфрама диаметром d=3 mm и длиной l=100 mm, установленный на оси системы. Газ (аргон, азот, кислород) напускался непосредственно в катодную полость и откачивался через торцевую часть $\widehat{3}$ катода, закрытую мелкоструктурной $(0.6\times 6\text{ mm})$ сеткой из нержавеющей стали. Давление газа в вакуумной камере при величине потока напускаемого в разрядный промежуток газа 1 cm^3 atm/s составляло 0.01 Pa. Вакуум создавался паромасляным насосом без ловушки. Продольное маг-

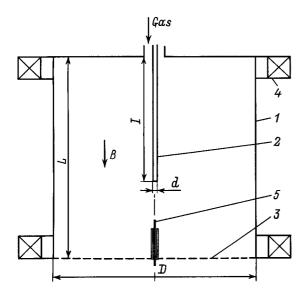


Рис. 1. Схема электродной системы.

нитное поле с индукцией 1 mT создавалось соленоидами 4. На оси разрядной системы установлен цилиндрический ленгмюровский зонд 5 диаметром 0.4 mm и длиной 6 mm.

Разряд возбуждался в импульсно-периодическом режиме с регулируемой в пределах $0.1-1300\,\mathrm{Hz}$ частотой повторения импульсов. Длительность импульсов регулировалась в пределах $0.1-1\,\mathrm{ms}$, длительность фронта импульса не превышала $5\,\mu\mathrm{s}$. Амплитуда U импульса напряжения, прикладываемого к промежутку, регулировалась в пределах $1-3\,\mathrm{kV}$. Нестабильность амплитуды импульса напряжения и частоты повторения не превышала 5%. Ток разряда регулировался в пределах $0.05-20\,\mathrm{A}$. В экспериментах по влиянию среднего тока разряда на напряжение горения импульсного разряда использовался непрерывный разряд с регулируемым в пределах $0.1-1\,\mathrm{A}$ током. Импульсное напряжение в этом случае прикладывалось к промежутку, в котором горел разряд постоянного тока.

Время запаздывания пробоя t определялось с момента приложения напряжения U до момента времени, соответствующего резкому спаду напряжения на разрядном промежутке до уровня 0.9U. Измерение напряжения горения разряда производилось после достижения установившейся величины тока разряда I. Приводимые данные усреднены по результатам 64 осциллографических измерений.

Перед проведением измерений проводилась продолжительная тренировка разрядной системы ($\sim 1\,\mathrm{h}$) при фиксированной величине среднего тока разряда до установления неизменных значений параметров импульсного разряда. На рис. 2 приведены зависимости времени t от длительности 1/f паузы между импульсами тока разряда в аргоне после тренировки со средним током 0.5 (кривая I) и $0.1\,\mathrm{A}$ (кривая 2). Рост f приводит к резкому уменьшению времени запаздывания t, при

этом значения t зависят от условий предварительной тренировки. Статистический разброс значений времени запаздывания уменьшается до минимальной величины $(\sim 2\%)$, обусловленной нестабильностью амплитуды и частоты импульсов и времени формирования разряда, уже при частоте $\sim 5 \, {\rm s}^{-1}$ (рис. 3). Наряду со снижением статистического разброса в диапазоне частот $f < 5 \,\mathrm{s}^{-1}$ наблюдается и снижение минимальных регистрируемых значений времени запаздывания. При дальнейшем росте частоты время запаздывания продолжает монотонно уменьшаться, разброс значений t при этом сохраняется минимальным. После замены аргона на азот или кислород и продолжительной тренировки катода характер зависимостей t(f) и изменения разброса значений t с частотой остается таким же, что и для разряда в аргоне. Отличительной особенностью импульсно-периодического разряда в кислороде является значительно меньшая скорость увеличения t при $f < 200 \,\mathrm{s}^{-1}$.

Вольт-амперная характеристика разряда в электродной системе типа обращенный магнетрон является растущей, причем величина дифференциального сопротивления разряда dU/dI с ростом тока уменьшается. Поэтому в импульсном сильноточном режиме ($I \sim 5-20\,\mathrm{A}$) напряжение горения разряда слабо зависит от амплитудной величины тока, но его величина может быть как выше, так и ниже напряжения горения более слаботочного разряда постоянного тока при одинаковых условиях в промежутке. Величина среднего тока разряда оказывает более существенное влияние на напряжение горения разряда в импульсно-периодическом режиме. На рис. 4 приведены результаты, иллюстрирующие влияние среднего тока в разрядном промежутке на напряжение горения импульсного и непрерывного разрядов. К промежутку, в котором поддерживался непрерывный разряд с регулируемым в пределах 0.1-1 А током, прикладывалось импульсное напряжение и возбуждался разряд с частотой

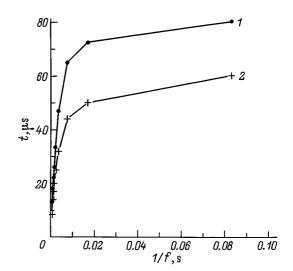


Рис. 2. Зависимость времени запаздывания пробоя от длительности паузы между импульсами тока разряда: $U=2\,\mathrm{kV},$ $I=2\,\mathrm{A},$ $\tau=0.1\,\mathrm{ms}.$

 $f=10\,\mathrm{s^{-1}}$ и амплитудным током 10 A. С увеличением постоянного тока возрастает напряжение не только непрерывного, но и импульсного разряда. После гашения разряда постоянного тока значения напряжения горения импульсного разряда уменьшаются до более низких исходных значений за несколько минут. В течение первых $1-2\,\mathrm{min}$ незначительно (на $\sim 5\,\mu\mathrm{s}$) возрастает время запаздывания разряда. Увеличение частоты повторения импульсов тока приводит к росту напряжений горения обоих разрядов.

Постоянная времени распада плазмы определялась по скорости изменения ионного тока в цепи отрицательно смещенного относительно катода ленгмюровского зонда после выключения разряда. Время спада напряжения на промежутке до нуля составляло несколько μ s. Оцененные значения постоянной времени распада находятся в пределах $15-20~\mu$ s.

Обсуждение результатов

Как известно, время t запаздывания разряда определяется как частотой ν появления в разрядном промежутке начальных электронов, так и временем формирования в промежутке структуры тлеющего разряда в результате развития серии таунсендовских лавин. Уменьшение статистического разброса значений t с ростом частоты (рис. 3) свидетельствует об увеличении тока начальных электронов. В условиях эксперимента этот ток может быть обусловлен наличием остаточных зарядов в промежутке, влиянием метастабильных атомов и молекул, а также послеразрядной электронной эмиссией катода [7]. Поскольку снижение плотности плазмы в объеме на стадии ее распада обусловлено рекомбинацией частиц

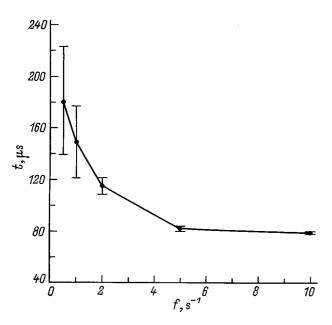


Рис. 3. Зависимость времени запаздывания пробоя от частоты повторения импульсов тока разряда: $U=2\,\mathrm{kV},\,I=10\,\mathrm{A},\,$ $\tau=1\,\mathrm{ms}.$

на стенках, то спад плотности должен происходить по экспоненциальному закону, что подтверждается экспериментально. В этом случае, как следует из оценок, влияние остаточных зарядов может проявляться на частотах порядка $1\,\mathrm{kHz}$ при постоянной времени распада плазмы $\sim 30\,\mu\mathrm{s}$. Поскольку изменение времени запаздывания наблюдается при значительно более низких частотах, а измеренные значения постоянной времени распада плазмы составляют $15-20\,\mu\mathrm{s}$, то можно заключить, что особенности зависимостей t(f) не связаны с наличием остаточных зарядов в объеме разрядного промежутка. Представляется маловероятным и существование метастабилей на поверхности катода в течение столь длительного времени ($\sim 0.1\,\mathrm{s}$).

В условиях эксперимента наиболее вероятной причиной появления в разрядном промежутке начальных электронов может быть послеразрядная электронная эмиссия катода. Характерный для послеразрядной эмиссии спад тока со временем позволяет объяснить поведение зависимостей t(f, 1/f), приведенных на рис. 2, 3. Уменьшение частоты ν появления начальных электронов при увеличении длительности пауз между импульсами тока приводит к росту средних значений t и их статического разброса. Особенностью описываемых экспериментов является использование катода с большой рабочей поверхностью, что привело к уменьшению статического разброса значений времени запаздывания и позволило проводить прямые измерения времени формирования разряда при невысокой плотности тока после эмиссии $(10^{-17}-10^{-16} \text{ A/cm}^2)$ с частично кондиционированной в разряде поверхности катода и исследовать зависимости времени формирования разряда от условий в промежутке и параметров импульсно-периодического режима.

Статистический разброс значений t снижается до минимальной величины при $f > 5 \,\mathrm{s}^{-1}$ (рис. 3). Дальнейшее уменьшение t с ростом f может быть обусловлено только изменением времени формирования тлеющего разряда. При изменении частоты f от 10 до 1300 Hz время формирования разряда в аргоне уменьшается в несколько раз (с 60-80 до $10-15 \mu s$ в условиях, соответствующих рис. 2). Влияние среднего тока разряда на этапе предварительной тренировки катода на величину tоказывается противоположным, т. е. рост тока приводит к увеличению t, а его уменьшение — к снижению времени задержки, однако изменения t в этом случае меньше, составляют $5-15 \,\mu s$ и происходят в течение достаточно продолжительного времени (нескольких минут). Такой характер зависимости t от среднего тока свидетельствует о том, что тренировка не сводится к обычной очистке поверхности катода от загрязнений, а обеспечивает установление некоторого равновесного состояния его поверхности после определенного периода релаксации.

Рост напряжения горения импульсного разряда наблюдается как при увеличении тока непрерывного разряда в том же промежутке (рис. 4), так и при изменении среднего тока импульсно-периодического разряда изменением частоты повторения импульсов [4]. Выключение разряда

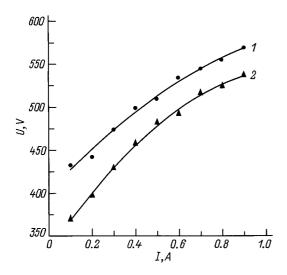


Рис. 4. Зависимость напряжений горения импульсного (1) и непрерывного (2) разрядов от величины тока непрерывного разряда. Параметры импульсно-периодического разряда: $I = 10 \,\mathrm{A}, \, f = 10 \,\mathrm{s}^{-1}, \, \tau = 1 \,\mathrm{ms}.$

постоянного тока приводит к восстановлению исходных значений напряжения и времени запаздывания в течение нескольких минут. После достижения установившегося состояния поверхности катода существенного изменения параметров импульсно-периодического режима разряда не наблюдается в течение продолжительного времени (несколько часов).

Исходя из полученных результатов можно заключить, что изменение среднего тока разряда существенно влияет на состояние поверхности катода, в результате чего изменяются как коэффициент ионно-электронной эмиссии, так и электронная послеэмиссия катода. При этом способ изменения величины среднего тока (изменением частоты повторения импульсов или изменением величин I, τ и тока постоянного разряда) оказывает различное влияние на изменение t и одинаковое на величину напряжения горения разряда. Такой характер изменения эмиссионных свойств катода можно объяснить исходя из предположения о существовании на поверхности катода непроводящих тонких пленок, условия регенерации и свойства которых в разряде определяются величиной среднего тока разряда.

Как известно [8], результат воздействия потока ионов на поверхность металла зависит от соотношения между плотностью ионного тока и потоком частиц остаточного газа, адсорбирующихся на поверхности катода. В обычных условиях режим преимущественного распыления и очистки катода достигается только при достаточно высокой плотности тока ионов $0.1-1\,\mathrm{mA/cm^2}$. При наличии в объеме химически активных примесей и при низкой плотности ионного тока может установиться динамическое равновесие процессов адсорбции и распыления, при котором на поверхности катода может длительное время существовать слой с измененным химическим составом

и структурой. В [9] прямыми измерениями состава поверхности катода в тлеющем разряде постоянного тока было показано, что уменьшение тока разряда со временем совпадает со снижением содержания загрязнений на поверхности катода, причем толщина загрязняющей кислород- и углеродсодержащей пленки составляет, по оценкам, лишь несколько десятков ангстрем. Присутствие на поверхности электродов тонких диэлектрических пленок и возникновение послеразрядной эмиссии с плотностью тока 10^{-15} — 10^{-18} A/cm² наблюдались в экспериментах [10] после всех видов очистки, включающих различные комбинации высокотемпературного отжига в вакууме и обработки электродов тлеющим разрядом.

Наличие непроводящих пленок на поверхности катода позволяет объяснить как особенности процесса зажигания, так и зависимость напряжения разряда в квазистационарной стадии его горения от параметров импульснопериодического режима. Уменьшение времени формирования t при увеличении частоты повторения f и соответственно рост тока послеразрядной эмиссии обусловлены тем, что при $t\gg 1/\nu$ реализуется режим многоэлектронного зажигания. Если ток в промежутке нарастает лавинообразно, т. е. $I(t) = I(0) \exp[-t(\mu - 1)/\tau]$, где τ время пролета иона, μ — коэффициент усиления тока в промежутке, то уменьшение времени формирования в несколько раз означает увеличение начального тока I(0) примерно на столько же порядков величины. Таким образом, наблюдаемое в экспериментах уменьшение t означает рост плотности тока послеэмиссии на 4-5 порядков при уменьшении временного интервала от 10^{-1} до 10^{-3} s.

Изучение динамики процесса послеэмиссии методом измерения времен запаздывания разряда проводилось в различных условиях и после разнообразных воздействий в целом ряде работ (см., например, [5,7,10]) в интервале времен от нескольких секунд до десятков часов. Общей закономерностью всех полученных результатов является рост скорости изменения тока послеразрядной эмиссии по мере уменьшения времени с момента прекращения разряда. Использование в наших экспериментах высокой частоты повторения импульсов позволило провести измерения с малой временной задержкой $(10^{-3} \, \text{s})$ относительно момента гашения разряда и обнаружить высокую скорость изменения тока послеразрядной эмиссии электронов при $1/f < 10^{-2} \, \text{s}$.

Известно, что адсорбция атомов основных загрязняющих примесей — кислорода и углерода на поверхности приводит к увеличению работы выхода металлов и соответствующему уменьшению коэффициента ионноэлектронной эмиссии γ [11]. Увеличение потенциальной эмиссии электронов возможно в результате формирования на поверхности металла проницаемой для бомбардирующих катод ионов тонкой непроводящей пленки и создания в ней электрического поля, облегчающего выход вторичных электронов из металла вследствие эффекта Шоттки. Такое поле создается в результате возникновения на поверхности пленки положительного

электрического заряда под действием излучения из разряда и вследствие осаждения положительных ионов [5,7]. Наличие микронеоднородностей на поверхности катода, способствующих усилению поля в пленке, обеспечивает возникновение послеразрядной автоэлектронной эмиссии катода.

Быстрый спад тока послеразрядной эмиссии со временем до невысоких значений свидетельствует о незначительном загрязнении катода, которое тем не менее оказывает существенное влияние на свойства импульсного разряда. Следует отметить, что наличие на катоде приповерхностного слоя с измененным составом и структурой не приводит к сколь-либо существенному загрязнению пучка газовых ионов [1].

Заключение

Состояние поверхности катода в тлеющем разряде в условиях несовершенного вакуума зависит от среднего тока разряда и оказывает существенное влияние на параметры процессов зажигания и горения импульсного разряда. На поверхности катода при низком среднем токе разряда формируются непроводящие тонкие пленки, наличие которых приводит к существенному уменьшению времени запаздывания разряда и напряжения его горения. С увеличением среднего тока влияние пленок уменьшается. Время релаксации параметров разряда при изменении среднего тока составляет несколько минут.

Методика, основанная на использовании катода с большой площадью рабочей поверхности и изменении в широких пределах частоты повторения импульсов, позволила с высоким временным разрешением исследовать динамику изменения послеразрядной эмиссии и обнаружить резкое увеличение плотности тока послеэмиссии при сокращении интервала времени после гашения разряда. Высокая плотность тока послеразрядной эмиссии с большой поверхности катода при повышенной частоте повторения импульсов тока обеспечивает многоэлектронное инициирование разряда, следствием чего является уменьшение времени формирования разряда.

Обнаруженная в эксперименте высокая степень влияния тонких пленок на эмиссионные свойства катода тлеющего разряда обусловливает необходимость учета их существования в экспериментах с импульсными тлеющими разрядами функционирующих в техническом вакууме устройствах на их основе.

Список литературы

- Gavrilov N.V., Mesyats G.A., Nikulin S.P. et al // J. Vac. Sci. Technol. 1996. Vol. A14(3). P. 1050–1055.
- [2] *Гаврилов Н.В., Завьялов М.А., Никулин С.П.* и др. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. Вып. 21. С. 57–60.
- [3] Gavrilov N.V., Nikulin S.P. // Proc. XVI Intern, Symp. on Dischardes and Electrical Insulation in Vacuum / Ed. G. Mesyats. Proc. SPIE. 2259. 1994. P. 118–121.

- [4] Gavrilov N.V., Mesyats G.A. // Proc. XXIII Intern. Conf. on Phenomena in Ionized Gases / Ed. M.C. Bordage & A. Gleizes. Toulouse: Univ. of P. Sabatier, 1997. Vol. 2. P. 32– 33
- [5] Paetow H. // Z. Physik, 1939. N 111. P. 770-791.
- [6] Kudrle V., Le Due E., Fitaire M. // Proc. XXIII Intern. Conf. on Phenomena in Ionized Gases / Ed. M.C. Bordage & A. Gleizes. Toulouse: Univ. of P. Sabatier, 1997. Vol. 4. P. 28–29.
- [7] Королев Ю.А., Месяц Г.А. Физика импульсного пробоя газов. М.: Наука, 1991.
- [8] Плешивцев Н.В. Катодное распыление. М.: Атомиздат, 1968.
- [9] Houston J.E., Bland R.D. // J. Appl. Phys. 1973. Vol. 44. N 6. P. 2504–2508.
- [10] Чистяков П.Н., Татаринова Н.В. // ЖТФ. 1965. Т. 35. Вып. 7. С. 1333–1355.
- [11] Каминский М. Атомные и ионные столкновения на поверхности металла. М.: Мир, 1967. 506 с.